

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 4 区分
 【発行日】平成 23 年 11 月 10 日 (2011.11.10)

【公開番号】特開 2009-120946 (P2009-120946A)
 【公開日】平成 21 年 6 月 4 日 (2009.6.4)
 【年通号数】公開・登録公報 2009-022
 【出願番号】特願 2008-271476 (P2008-271476)
 【国際特許分類】

C 2 3 C 14/04 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/04 A

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 9 月 22 日 (2011.9.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被成膜基板を少なくとも第 1 の領域と第 2 の領域との 2 つの領域に分け、
 前記被成膜基板より小さい面積の第 1 のシャドーマスクおよび第 2 のシャドーマスクを用い、

前記第 1 の領域に対して前記第 1 のシャドーマスクの位置合わせを行い、前記第 1 の領域に蒸着材料を成膜し、

前記第 2 の領域に対して前記第 2 のシャドーマスクの位置合わせを行い、前記第 2 の領域に蒸着材料を成膜することを特徴とする成膜方法。

【請求項 2】

被成膜基板を少なくとも第 1 の領域と第 2 の領域との 2 つの領域に分け、
 前記被成膜基板より小さい面積のシャドーマスクを用い、
 前記第 1 の領域に対して前記シャドーマスクとの位置合わせを行い、前記第 1 の領域に蒸着材料を成膜し、

次に、未成膜領域に前記シャドーマスクを移動し、位置合わせを行い、蒸着材料を成膜し、

前記工程を複数回繰り返すことを特徴とする成膜方法。

【請求項 3】

被成膜基板と、前記被成膜基板より小さい面積のシャドーマスクと、平面状の蒸着源とを用い、

前記シャドーマスクを移動して、前記被成膜基板との位置合わせを行い、

平面状の蒸着源から蒸着材料を気化し、

前記被成膜基板の少なくとも一部に前記蒸着材料を成膜する工程を複数回行うことを特徴とする成膜方法。

【請求項 4】

被成膜基板と、前記被成膜基板より小さい面積のシャドーマスクと、支持基板とを用い

、

前記シャドーマスクを移動して、前記被成膜基板との位置合わせを行い、
光源ユニットからの光を前記支持基板に照射し、

照射光を前記支持基板に設けられた光吸収層に吸収させることにより、前記支持基板に
設けられた蒸着材料を加熱し、

前記蒸着材料の少なくとも一部を気化させ、

前記シャドーマスクの開口部を介して、前記被成膜基板の表面の少なくとも一部に、前
記蒸着材料を成膜し、

前記被成膜基板または前記シャドーマスクを移動する工程を複数回行うことを特徴とす
る成膜方法。

【請求項 5】

請求項 4 において、

前記光源ユニットは、前記シャドーマスクとともに移動させることを特徴とする成膜方
法。

【請求項 6】

請求項 4 または請求項 5 において、

前記光源ユニットから射出された光は、赤外光であることを特徴する成膜方法。

【請求項 7】

請求項 4 乃至請求項 6 のいずれか一項において、

前記光吸収層は、前記光源ユニットから射出された光に対して、吸収率が 40 % 以上で
あることを特徴とする成膜方法。

【請求項 8】

請求項 4 乃至請求項 7 のいずれか一項において、

前記光吸収層の膜厚は、200 nm 以上 600 nm 以下であることを特徴とする成膜方
法。

【請求項 9】

請求項 4 乃至請求項 8 のいずれか一項において、

前記光吸収層は、窒化タンタル、チタン、カーボンのいずれかを含むことを特徴とする
成膜方法。

【請求項 10】

請求項 4 乃至請求項 9 のいずれか一項において、

前記支持基板は、湿式法を用いて、蒸着材料を付着させることを特徴とする成膜方法。

【請求項 11】

請求項 1 乃至請求項 10 のいずれか一項において、

前記蒸着材料は、有機化合物であることを特徴とする成膜方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】成膜方法